```
T S1/5/1
 1/5/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
014679445
WPI Acc No: 2002-500502/200253
XRAM Acc No: C02-141781
XRPX Acc No: N02-396276
 Substrate for solar cell comprises support consisting of metal surface
provided with zinc oxide film having preset water content
Patent Assignee: CANON KK (CANO ); MIYAMOTO Y (MIYA-I); SONODA Y (SONO-I);
  TOYAMA N (TOYA-I)
Inventor: MIYAMOTO Y; SONODA Y; TOYAMA N
Number of Countries: 024 Number of Patents: 007
Patent Family:
Patent No
             Kind
                    Date
                            Applicat No
                                            Kind
                                                  Date
                                                            Week
WO 200247175
              A2 20020613
                            WO 2001JP10581 A
                                                 20011204
                                                           200253 B
                  20020618 AU 200223133
                                             Α
                                                 20011204
                                                           200262
AU 200223133
              Α
                                                           200271
                                                 20011203
                  20020823 JP 2001368243
                                             Α
JP 2002237606 A
US 20030019519 A1 20030130 WO 2001JP10581 A
                                                20011204 200311
                            US 2002208868
                                           Α
                                               20020801
              A2 20030910
                            EP 2001999976
                                             A 20011204
                                                           200367
EP 1342274
                             WO 2001JP10581 A
                                               20011204
US 6660931
                 20031209
                            WO 2001JP10581 A
                                                 20011204
                                                           200381
              B2
                            US 2002208868
                                             Α
                                                 20020801
                  20040121 CN 2001806023
                                             A
                                                 20011204
                                                           200425
CN 1470078
              Α
Priority Applications (No Type Date): JP 2001368243 A 20011203; JP
  2000367986 A 20001204
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
                                     Filing Notes
WO 200247175 A2 E 42 H01L-031/0224
   Designated States (National): AU CN US
   Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU
   MC NL PT SE TR
                      H01L-031/0224 Based on patent WO 200247175
AU 200223133 A
JP 2002237606 A
                    9 H01L-031/04
                                      Cont of application WO 2001JP10581
US 20030019519 A1
                       H01L-031/00
                      H01L-031/0224 Based on patent WO 200247175
EP 1342274
             A2 E
   Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI
   LU MC NL PT SE TR
                      H01L-031/0224 Cont of application WO 2001JP10581
US 6660931
             B2
                      H01L-031/0224
CN 1470078
             Α
Abstract (Basic): WO 200247175 A2
        NOVELTY - A substrate for a solar cell, comprises a support
    consisting of metal surface provided with zinc oxide film. The zinc
    oxide film has water content of 7.5 x 10 to the power -3 mol/cm cubed
    or less.
        DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for the
    following:
        (1) Solar cell comprising substrate; and
        (2) Process for producing solar cell.
        USE - For solar cells (claimed).
        ADVANTAGE - The substrate has enlarged surface area and is
    industrially produced. The zinc oxide film is slightly rich in oxygen
    when compared to zinc, hence is chemically stable in reduction
```

atmospheric conditions during production of solar cells on substrates,

## **BEST AVAILABLE COPY**

and enables to form solar cells having favorable optical properties. Uniform zinc oxide film is efficiently formed on metal surface with scarce abnormal growth, by controlling electric conductivity of zinc oxide film forming solution to 10 mS/cm at 60 degreesC. The substrate prevents increase in series resistance and generation of shunt when used for solar cells.

pp; 42 DwgNo 0/0

Title Terms: SUBSTRATE; SOLAR; CELL; COMPRISE; SUPPORT; CONSIST; METAL; SURFACE; ZINC; OXIDE; FILM; PRESET; WATER; CONTENT

Derwent Class: L03; U12

International Patent Class (Main): H01L-031/00; H01L-031/0224; H01L-031/04

International Patent Class (Additional): C23C-016/40; H01L-031/18

File Segment: CPI; EPI

?

## SUBSTRATE FOR SOLAR CELL, SOLAR CELL USING THE SAME, AND METHOD OF MANUFACTURING THE SOLAR CELL

Patent number:

JP2002237606

**Publication date:** 

2002-08-23

Inventor:

TOYAMA JO; SONODA YUICHI; MIYAMOTO YUSUKE

Applicant:

**CANON INC** 

Classification:

international:

H01L31/04

- european:

Application number: JP20010368243 20011203

Priority number(s):

#### Also published as:



WO0247175 (A3) WO0247175 (A2) US6660931 (B2) US2003019519 (A1) JP2002237606 (A)

Abstract of JP2002237606

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a solar cell having a zinc oxide film the various characteristics of which are optimized collectively by taking a measure to increase the Rs of the film, preventing the occurrence of shunts in the film, and improving the efficiency (particularly Jsc) and chemical stability of the film.

SOLUTION: The solar cell uses a substrate having a metal surface, on which the zinc oxide film which is adjusted in moisture content to <=7.5× 10-3 mol/cm3, preferably, to >=4.0× 10-4 mol/cm3 is formed.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-237606 (P2002-237606A)

(43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

H01L 31/04

H01L 31/04

M 5F051

#### 審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号 特颐2001-368243(P2001-368243) (71)出頭人 000001007 キヤノン株式会社 (22)出廣日 平成13年12月3日(2001.12.3) 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 遠山 上 (31) 優先権主張番号 特顧2000-367986 (P2000-367986) 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ (32) 優先日 平成12年12月 4日(2000.12.4) ノン株式会社内・ (33) 優先権主張国 日本 (JP) (72)発明者 圏田 雄一 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (74)代理人 100096828 弁理士 渡辺 敬介 (外2名)

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 太陽電池用基板、それを用いた太陽電池及び太陽電池の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 Rsが大きくなる対策、シャントの防止、効率の向上(特にJsc)、化学的安定性の向上を図り、総合的に見て諸特性が最適な酸化亜鉛膜を有する太陽電池を得る。

【解決手段】 金属表面を有する基板上に、単位体積あたりの水分量が7.5×10-1mol/cm<sup>3</sup>以下、好ましくは4.0×10-1mol/cm<sup>3</sup>以上である酸化亜鉛膜が形成されている太陽電池用基板を用いる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属表面を有する基板上に、膜中の水分 量が7.5×10-3mol/cm3以下である酸化亜鉛 膜が形成されているととを特徴とする太陽電池用基板。 【請求項2】 前記酸化亜鉛膜の膜中の水分量が4.0 ×10-4mol/cm3以上であることを特徴とする請 . 求項1 に記載の太陽電池用基板。

【請求項3】 前記酸化亜鉛膜の膜中の水分量が1.0 ×10-imol/cmi以上5.0×10-imol/c m<sup>1</sup>以下であることを特徴とする請求項2に記載の太陽 電池用基板。

【請求項4】 前記酸化亜鉛膜は、水溶液からの電気化 学的反応による電析法により形成された膜であることを 特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の太陽電池 用基板。

【請求項5】 前記酸化亜鉛膜は、水を含有する雰囲気 下でスパッタリング法により形成された膜であることを 特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の太陽電池 用基板。

を特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の太陽電 油用基板.

【請求項7】 前記金属表面の金属が銀、アルミニウ ム、銅、銀合金、アルミニウム合金、銅合金のいずれか であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記 載の太陽電池用基板。

【請求項8】 請求項1乃至7のいずれかに記載の太陽 電池用基板の上に、少なくとも半導体層を有することを 特徴とする太陽電池。

【請求項9】 基板上に水溶液を用いて酸化亜鉛膜を形 30 成する工程と、該酸化亜鉛膜を第一の温度で乾燥する工 程と、該酸化亜鉛膜上に前記第一の温度+100℃以下 の第二の温度で半導体層を形成する工程とを有すること を特徴とする太陽電池の製造方法。

【請求項10】 前記第二の温度を前記第一の温度以下 とすることを特徴とする請求項9に記載の太陽電池の製 造方法。

【請求項11】 前記第一の温度を200℃以上400 °C以下とすることを特徴とする請求項9または10に記 載の太陽電池の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ある一定量以下の 水分を膜中に含んだ酸化亜鉛薄膜が金属表面を有する基 板上に形成された太陽電池用基板、それを用いた太陽電 池及び太陽電池の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】真空プロセスによって酸化物薄膜を形成 する方法としては、蒸着法、スパッタ法、CVD法等が 良く知られている。これらの方法で酸化物薄膜を作製す 50 を有する基板上に、膜中の水分量が7.5×10°mo

る場合には、真空炉壁に吸着している水分が薄膜中に取 り込まれる可能性はある。しかしながら、このような場 合の膜中水分量に関して記載された先行技術はない。

【0003】真空プロセス中に積極的に水分子を導入し . て酸化物を形成する方法に関しては、たとえば、特開昭 61-64874号公報で開示されている。それによる と、「水蒸気を添加したアルゴンガスをスパッタガスと して、酸化物の堆積を行う。」とあるが、特に、堆積後 の酸化膜中に含まれる水の量に関しての記載はない。

【0004】真空プロセスに代わり、水溶液の電気化学 的反応を利用して酸化物を堆積する方法(電析法)がい くつか開示されている。たとえば、特開平11-302 89号公報「酸化物薄膜の製造方法」では、金属種を含 む水和物または水酸化物または含水物を基板上に堆積さ せた後、通電パルスのデューティー比を変えることによ り溶解を押さえながら脱水を行い目的酸化物を作製す る。ととでは、電析法により堆積された酸化物に何等か の形で水が存在することが従来技術として開示されてい る。更に、その水等の存在が膜の信頼性を下げてしまう 【請求項6】 前記酸化亜鉛膜が複数の層からなること 20 ために脱水が必要であると記載されている。しかしなが ら、目的酸化物中に含まれる水の量に関しての記載は一

> 【0005】また、特開平10-140373号公報で は、硝酸イオンと亜鉛イオンを含む水溶液に炭水化物を 添加した水溶液中で、電流を流すことにより基板側に酸 化亜鉛薄膜を形成する方法(電析法による)が開示され ている。しかしながら、酸化亜鉛薄膜中に含まれる水の 量に関しての記載はない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、酸化物 薄膜中に含まれる水分量によって太陽電池用基板として の適、不適があるのではないかと考えた。そこで、太陽 電池用として最適な基板を得るために、スパッタ法によ る酸化亜鉛膜の検討、スパッタ法による水蒸気の導入に よる酸化亜鉛膜の検討、および電析法による水溶液中か らの析出による酸化亜鉛膜の検討を行った。

【0007】その結果、電析法による水溶液中からの析 出によって作製した酸化亜鉛膜では、電気抵抗値が一定 しないという不都合が見出された。その理由は明らかで 40 はないが、2桁以上抵抗が変化をし、高抵抗になった場 合には太陽電池の初期特性を下げてしまった。

【0008】また、特に、工業的生産性を考えて大面積 化をする際には、均一性、密着性等が不十分であるとと があった。

【0009】本発明は、上記事情に鑑み、総合的に見て 諸特性が最適な酸化亜鉛膜を有する太陽電池用基板及び それを用いた太陽電池を得ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するため手段】即ち、本発明は、金属表面

1/cm'以下である酸化亜鉛膜が形成されていること を特徴とする太陽電池用基板に関する。

【0011】上記本発明の太陽電池用基板は、更なる好 ましい特徴として、「前記酸化亜鉛膜の膜中の水分量が 4. 0×10-4mol/cm³以上であること」、「前 記酸化亜鉛膜の膜中の水分量が1.0×10<sup>-3</sup>mo1/ cm'以上5.0×10-'mol/cm'以下であるこ と」、「前記酸化亜鉛膜は、水溶液からの電気化学的反 応による電析法により形成された膜であること」、「前 グ法により形成された膜であること」、「前記酸化亜鉛 膜が複数の層からなるとと」、「前記金属表面の金属が 銀、アルミニウム、銅、銀合金、アルミニウム合金、銅 合金のいずれかであること」、を含む。

【0012】また本発明は、上記本発明の太陽電池用基 板の上に、少なくとも半導体層を有することを特徴とす る太陽電池に関する。

【0013】さらに本発明は、基板上に水溶液を用いて 酸化亜鉛膜を形成する工程と、該酸化亜鉛膜を第一の温 度で乾燥する工程と、該酸化亜鉛膜上に前記第一の温度 20 た測定系自体に 0.1 Ω c m²程の回路抵抗があるの +100°C以下の第二の温度で半導体層を形成する工程 とを有することを特徴とする太陽電池の製造方法に関す る。なお、前記半導体層の上に、さらに半導体層などの 層を形成する場合、との層(前記酸化亜鉛膜と直接、接 していない層)の形成温度は問わない。

【0014】かかる発明に至った経緯について下記に示

【0015】本発明者らは、前述した酸化亜鉛膜を有す る太陽電池用基板における問題点が、酸化亜鉛膜中に含む まれる水分量に大きく依存するのではないかと考え、以 30 800mmの値を用いたが、測定結果に振幅がある場合 下のような実験を行った。

【0016】(水分量の測定と抵抗値、反射率等との関 係)市販のスパッタ装置(日本真空製)にて、SUS4 30 (2D表面) 基板上にアルゴン雰囲気中で設定温度 200℃で、銀を800nm、続けて酸化亜鉛膜を1μ米 \* n成膜した(サンプルA)。

【0017】次に、同様の条件で銀を成膜した後、水の 分圧を5, 10, 15, 30%と変化させ、酸化亜鉛膜 を1 µm成膜した(サンプルB~E)。さらに、水の分 圧を0. 1%に変化させて酸化亜鉛膜を1μπ成膜した サンブルも用意した(サンブルし)。

【0018】更に、上記条件で銀を成膜した基板をカソ ードとし、亜鉛板をアノードとして硝酸亜鉛水溶液中よ り電析法にて銀上に酸化亜鉛を1μπ成膜した(サンブ 記酸化亜鉛膜は、水を含有する雰囲気下でスパッタリン 10 ルF)。また、このサンブルFに対して、いくつか異な る乾燥条件のもとで乾燥させたサンプルを作製した (サ ンプルG~K)。

> 【0019】とうして各サンプルを数枚ずつ作製し、カ ールフィッシャー水分測定器(京都電子製 MKC-5 10) にかけて水分量を測定した。

> 【0020】また、各サンブルの酸化亜鉛膜上に真空蒸 着機で0.25cm゚のマスクを用いてCr続いてAu の金属を蒸着し上部電極とし、SUS基板との間の電気 抵抗の値を測定した。電気抵抗の測定は、測定針を含め

> で、その程度は誤差を含むと考えられる。 【0021】さらに、各サンプルの全反射率、乱反射率

> を分光計(日本分光製 V-570)にて波長400n m~1200nm範囲で測定した。

【0022】測定結果を表1に示す。水分量は、酸化亜 鉛膜の基板表面8cm²あたりの水分量を測定し、酸化 亜鉛膜 1 c m' あたりに含まれる水分量に換算したもの をmol教で表示した。電気抵抗の値は上述した誤差を 含んだ無補正の値である。全反射率、乱反射率は、波長 には、振幅の山と谷に接する曲線をそれぞれ描き、波長 800nmでの山に接した曲線の値と谷に接した曲線の 値との平均値を用いた。

[0023]

【表1】

各成膜条件における酸化亜鉛膜中の水分量と電気抵抗、反射率の関係。									
わアル 名	主な作製条件	水分量(not/en³)	超気抵抗 (Q cm²)	全反射率(%)	乱反射率 (%)				
Α.	スパッタ、水なし	(0. 18~0. 35) ×10 <sup>-3</sup>	0. 20~0. 32	92	68				
В	スパック、水分圧 5%	(0. 57~1. 01) ×10⁻³	0. 35~0. 50	92	73				
С	か 79、水分圧 10%	(0.68~1.09) ×10 <sup>-9</sup>	0. 32~0. 53	93	72				
D	スパック、水分圧 15%	(0.70~1.13) ×10⁻³	0. 38~0. 55	93	75				
Е	スパッタ、水分圧 30%	(0.75~1.21)×10 <sup>-8</sup>	0. 46~0. 58	93	75				
P	電析、乾燥なし	(0.77~1.08) ×10 <sup>-2</sup>	26~95. 5	93	78				
G	型析、乾燥条件①	(0.70~0.96)×10 <sup>-2</sup>	. 2. 8~18. 2	93	79				
Н	理析、乾燥条件②	(0.55~0.73)×10 <sup>-2</sup>	3. 0~3. 4	93	79				
I	是折、乾燥条件③	(0.44~0.63)×10 <sup>-2</sup>	0. 50~0. 55	93	78				
· J	<b>電析、乾燥条件④</b>	(0. 24~0. 32) ×10 <sup>-2</sup>	0. 45~0. 48	93	79				
K	包析、乾燥条件⑤	. (0.78~1.11)×10 <sup>-8</sup>	0. 45~0. 60	93	77				
L_	スパック.水分圧 0.1%	(0. 38~0. 46) ×10 <sup>-3</sup>	0. 25~0. 42	92	70				

導入していないにもかかわらず、成膜後の膜に水分が含 まれていると考えられる。これは、真空炉壁に吸着して いた水が膜中に取り込まれた分と水分量測定までの間に 大気中の水分が膜表面に吸着した分であると考えられ

【0025】スパッタ中に水を加えたサンプルB~Eで は、ほんのわずかではあるが酸化亜鉛膜中に取り込まれ る水分量が増えていくのが分かる。

【0026】電析法(乾燥なし)で作製したサンプルF には、スパッタにより形成したサンプルに比べて10倍 10 以上の水分が含まれている。電析法で作製したサンブル . F~Kは、乾燥温度、乾燥時間を変えることで酸化亜鉛 膜中の水分量を任意に調整するととができる。ととで は、サンブルトからサンブル」にかけて水分量を減らし

【0027】各サンプルの反射率は、全反射率はほとん ど変わらないが、乱反射率は水分量の増加と共に増え、 おおむね水分量が1×10-1mol/cm<sup>1</sup>程度で乱反 射率が77~79%となる。との乱反射率の増加は、成 は水分子という形での酸素と成膜中に水が分解してでき た酸素、電析法ではそのほとんどが水分子という形での 酸素と考えている)により酸化亜鉛膜の透明度が上がっ たこと、および、理由は分からないが、水を含むことに より酸化亜鉛膜の表面のモロフォロジーが凹凸の進む方 向に変化したためと考えられる。

【0028】太陽電池用基板としては乱反射率が高けれ ば高いほど光閉じ込め効果によるJscの向上が期待で きる。本実験のように、基板表面の金属層に銀を用いた 場合には、乱反射率が70%以上あれば光閉じ込めの効 30 果は、サンブルMで10点、サンブルJで8点だった。 果は十分期待できるが、水をより多く含んだサンブルで はよりこの効果によるJscの向上が期待できる。

【0029】酸化亜鉛膜中に含まれる水分量が増えるに 伴い、おおむね電気抵抗の値も少しずつ増える。太陽電 池に用いた場合には、ある程度の電気抵抗を持っていた 方がシャントを引き起としにくいのでむしろ少々の電気 抵抗はあった方が良い。特に、髙温、髙湿の環境下では シャントしにくいという観点で著しい効果が期待でき

【0030】しかしながら、サンブルF、Gでは、電気 40 抵抗の値が非常に高く、太陽電池用基板として使用した 場合、太陽電池のシリーズ抵抗を上げてしまい、初期の 特性を著しく低下させてしまうおそれがある。電気抵抗 の値としては、サンプルHの3.0~3.4Qcm²が 太陽電池として用いるには、ほぼ上限である。このこと から、酸化亜鉛膜中の水分量は0.75×10-1mol /cm'以下であるのが好適である。

【0031】(還元雰囲気中での加熱)表1中のサンプ ルA、サンブルD、サンブルJ、サンプルLを真空炉内 で水紫雰囲気中に133Pa(1Torr)、400℃ 50 下が最適範囲であると言いうる。

で30分間加熱した後、取り出し、目視にて表面を観察 した。サンプルD、サンプルJでは、加熱前後での変化 は見られなかったが、サンプルAに関しては、加熱後に 酸化亜鉛膜表面が黒ずんでいた。また、サンブルした関 しては、加熱後わずかな黒ずみが見られる場合があっ た。これらは、太陽電池としての特性に問題はないと考 えられるが、水をより含んでいた方が、還元雰囲気中で は、より安定であった。これは、水をある程度以上、具 体的には4. 0×10<sup>-3</sup>mo1/cm<sup>3</sup>以上含んだサン プルD、サンプルJ、サンブルLの場合には、わずかな がら亜鉛に対して酸素リッチな酸化亜鉛膜であるがため に、この基板上に太陽電池 (半導体膜)を形成する際と 同等の条件の還元雰囲気中でも化学的に安定で、光学的 特性を損なわれないためと考えられる。

【0032】(電子顕微鏡による観察)表1中のサンプ ルA、サンプルB、サンプルD、サンプルJの酸化亜鉛 膜表面を電子顕微鏡で観察した。水の量が増えていくに 連れて、表面の凹凸が少しずつ進んでいくのがわかっ た。特に、サンプル」では、他のサンプルに比べ凹凸が 膜中に酸化亜鉛膜中に取り込まれた酸素(スパッタ法で 20 進んでいた。これは、ある程度以上の水を含んでいるた め、水が存在するための粒界のようなものが通常のスパ ッタ等の真空プロセスで作った酸化亜鉛膜より多いた め、どつどつと岩がとろがっているような形状を形成す ると思われる。そのため、高い乱反射率が得られ、光閉 込め効果によるJScの向上がより期待できる。

【0033】(クロスハッチ試験/碁盤目テーブ法)サ ンプルA上にサンプル」と同一処方で酸化亜鉛膜のみを 形成したものをサンプルMとし、サンブルMとサンプル Jのクロスハッチ試験(JIS規格)を行った。試験結 【0034】以上、いくつかの実験からわかったこと は、酸化亜鉛膜中に含まれる水分量が増えていくに伴 い、酸化亜鉛膜表面の凹凸が発達すること、乱反射率が 増加することがわかった。また、酸化亜鉛膜中に含まれ る水分量が増えていくに伴い、電気抵抗はわずかずつ増 加し、シャントを起としにくくする効果が期待できる。 しかしながら、膜中の水分量が多すぎる場合には電気抵 抗が不安定だったり、高抵抗となったりして太陽電池用 基板としては不適であった。

【0035】また、密着性という観点では、単層より2 層にしたぼうがより優れていた。

【0036】本発明者らは、以上の実験結果に基づき、 前記目的を達成すべく鋭意検討した結果、上述の構成を 有する本発明を完成した。

【0037】以上のことから、酸化亜鉛膜中の水分量は 7. 5×10<sup>-3</sup>mol/cm³以下が好ましく、4. 0 ×10<sup>-1</sup>mol/cm<sup>1</sup>以上がより好ましい。さらに、 低抵抗でかつ高乱反射率という観点からは、1.0×1 0-'mol/cm'以上5. 0×10-'mol/cm'以 [0038]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態に用いられる金 「厲表面を有する基板、および電析法について以下に述べ る。

【0039】(金属表面を有する基板)本発明に用いら れる基板材料は、酸化亜鉛膜成膜面に光学的に反射率の 高い材料を有するものが適している。また、電気化学的 に酸化亜鉛膜を堆積する際には、酸化亜鉛膜成膜面に電 気的な導通がとれ、電析浴に短時間で侵されない金属表 面のものなら使用でき、SUS、Ag、Al、Cu、F 10 る事ができ、成膜面の均一性を良好にできる。このよう e、これらの合金などの金属が用いられる。金属コーテ ィングを施したPETフィルムなども利用可能である。 これらの点から、太陽電池用基板として用いるには、酸 化亜鉛膜成膜面に、特に、銀、アルミニウム、銅、銀合 金、アルミニウム合金、銅合金を有するものが優れてい る。また、大面積化を伴う工業的な生産を考えた場合、 素子化プロセス等を後工程で行うには、SUS製の長尺 基板の表面上に銀、アルミニウム、銅、銀合金、アルミ ニウム合金、銅合金が堆積されたものが優れている。 【0040】SUSは非磁性SUS、磁性SUSいずれ 20 も適用できる。前者の代表はSUS304であり研磨性 に優れていて0. 1 s 程度の鏡面とすることも可能であ る。後者の代表はフェライト系のSUS430である。 【0041】SUSの表面は、平滑でも良いし、粗面で もよい。SUSの圧延プロセスにおいて圧延ローラーの 種類を変えたりすることにより表面性が変わる。BAと 称するものは鏡面に近く、2Dにあっては凹凸が顕著で ある。いずれの面においても、SEM (電子顕微鏡)下 での観察では、ミクロン単位の抉れなどが目立つことが ある。太陽電池用基板としては、大きなうねり状の凹凸 30 よりも、ミクロン単位の構造の方が太陽電池の特性に は、良い方向にも悪い方向にも大きく反映する。

【0042】銀、アルミニウム、銅、銀合金、アルミニ ウム合金、銅合金の表面は、平滑でも良いし、粗面でも よい。太陽電池用基板としては、適度なミクロン単位の 凹凸構造を有すると乱反射率の向上が期待できる。しか しながら、凹凸構造がきつすぎると太陽電池のVocを 落してしまったり、シャントを誘発してしまったりする 場合もあるので、注意が必要である。また、金属表面が ることで、上記と同じように乱反射率の向上が期待でき る。との際にも、凹凸構造がきつすぎると太陽電池のV OCを落してしまったり、シャントを誘発してしまった りする場合もあるので、注意が必要である。

【0043】(電析法)ビーカー等の耐腐食容器に、電 解析出水溶液を入れ、磁気撹拌子で撹拌しながら、金属 表面を有する基板をカソードとし、対向電極をアノード として直流電源を接続し通電することにより、カソード 上に酸化亜鉛膜を形成する。

イオンと亜鉛イオンを含む水溶液であり、その濃度は好 ましくは、0.002moi/1~3.0mol/1、 さらに好ましくは0.01mol/l~1.5mol/ 1、最適には0.05mol/1~0.7mol/1で ある。この様にすることで、光閉じ込め効果に適したテ クスチャー構造の酸化亜鉛膜を効率よく形成できる。

【0045】また、サッカロースまたはデキストリンを 水溶液に含有させると、これら添加剤が電解析出反応を 適正化するように働いて酸化亜鉛膜の異常成長を抑制す にする事で光閉じ込め効果の高い、テクスチャー構造の 酸化亜鉛膜を、歩留まりよく形成することができる。こ のようにサッカロースまたはデキストリンを含ませる場 合には、サッカロースの濃度は好ましくは、1g/1~ 500g/1、さらに好ましくは $3g/1\sim100g/$ lであり、デキストリン濃度は好ましくは0.01g/  $1\sim10$ g/1、さらに好ましくは0.025g/ $1\sim$ 1g/1である。

【0046】基板と対向電極間に流す電流値は、好まし くは0. lmA/cm'~100mA/cm'、さらに好 ましくは1mA/cm'~30mA/cm'、最適には4  $mA/cm^2\sim 20mA/cm^2$   $cm^2$ 

【0047】また、浴中のpHは3以上、電気伝導度は 10mS/cm以上、溶液温度は60℃以上とすること で、異常成長の少ない均一な酸化亜鉛膜を効率よく形成 できる。

[0048]

【実施例】(実施例1)厚さ0.15mmのSUS43 0 (2 D表面) 板を5 c m 角に切り出した。この板上に スパッタ装置(ULVAC製 SBH-2206DE) で、アルゴン雰囲気中O.399Pa (3.0mTor r)、350℃、0.3Aの定電流を印加し、銀を8.0 0 n m成膜した。

【0049】次に、硝酸亜鉛0、2モルとデキストリン 0.1gを純水1リットルに溶解した水溶液をビーカー にとり、82℃に加熱した。この水溶液中で前記スパッ タにて作製したSUS/銀基板をカソードとし、純度4 Nの5cm角の亜鉛板をアノードとして直流電流を定電 流モードで180mA印可し、厚さ1.2μmの酸化亜 平滑な場合には、酸化亜鉛膜で凹凸、形状等を変えてや 40 鉛膜をSUS/銀基板上に成膜した。この時のアノード と基板の間の距離は2cmとした。また、成膜中は、磁・ 気撹拌子で水溶液を撹拌した。

> 【0050】とうして得られたサンブルをポータブル電 気炉(アサヒ理化製作所製 AFM-10)にいれ、設 定温度300℃で10秒間加熱し、取り出し、カールフ ィッシャー水分測定器(京都電子製 MKC-510) にかけて水分量を測定した。

[0051]また、上記酸化亜鉛膜上に真空蒸着機で 25cm<sup>2</sup>のマスクを用いてCr続いてAuの金属 【0044】電解析出水溶液としては、少なくとも硝酸 50 を蒸着し上部電極とし、SUS基板との間の電気抵抗の 値を測定した。電気抵抗の測定は、測定針を含めた測定 系自体に 0. 1 Ω c m '程の回路抵抗があるので、その 程度は誤差を含むと考えられる。

【0052】さらに、それぞれのサンプルの全反射率、 乱反射率を分光計(日本分光製 V-570)にて波長 400nm~1200nmの範囲で測定した。

【0053】水分量は、酸化亜鉛膜の基板表面8cm<sup>2</sup> あたりの水分量を測定し、酸化亜鉛膜1cm あたりに 含まれる水分量に換算したものをmol数に換算した。 電気抵抗の値は上述した誤差を含んだ無補正の値であ る。全反射率、乱反射率は、測定結果に振幅があったた め、振幅の山と谷に接する曲線をそれぞれ描き、波長8 00 nmでの山に接した曲線の値と谷に接した曲線の値 との平均値を用いた。

【0054】その結果は、水分量が5、0×10<sup>-3</sup>mo 1/cm'、電気抵抗は0.50Ωcm'、全反射率は9 2%、乱反射率は79%であり、太陽電池用基板として は十分な値を示した。

【0055】(実施例2)実施例1と同様に酸化亜鉛膜 製 AFM-10)にいれ、設定温度400℃で5秒間 加熱し、取り出し、水分量、電気抵抗、反射率の測定を 行った。

【0056】その結果は、水分量が4.2×10-1mo 1/cm<sup>1</sup>、電気抵抗は0.51Ωcm<sup>2</sup>、全反射率は9 3%、乱反射率は79%であり、太陽電池用基板として は十分な値を示した。

【0057】(実施例3)実施例1と同様に酸化亜鉛膜 まで堆積した後、ボータブル電気炉(アサヒ理化製作所 間加熱し、取り出し、水分量、電気抵抗、反射率の測定 を行った。

【0058】その結果は、水分量が5.5×10-1mo 1/cm'、電気抵抗は3.1Qcm'、全反射率は93 %、乱反射率は78%であった。電気抵抗の値は、実施 例1、実施例2に比べて少し高く、太陽電池用基板とし ては上限であるが、実用上は問題のない値を示した。

【0059】(実施例4)厚さ0.15mmのSUS4米

\*30(2D表面) 板を5cm角に切り出した。この板上 にスパッタ装置(ULVAC製 SBH-2206D . E) で、アルゴン雰囲気中O. 399Pa(3.0mT orr)、350℃、0.3Aの定電流を印加し、銀を 800nm成膜した。

【0060】続けて酸素分圧が30%となるように酸素 を導入し、アルゴンと酸紫の混合雰囲気中0.466P a (3.5mTorr)、350℃、0.5Aの定電流 を印加し、酸化亜鉛膜を1.2μπ成膜し、水分量、電 10 気抵抗、反射率の測定を行った。

【0061】その結果は、水分量が1.1·1×10~3m 01/cm'、電気抵抗は0.52Qcm'、全反射率は 92%、乱反射率は74%と太陽電池用基板として十分 な値を示した。

【0062】(比較例1)実施例1と同様に酸化亜鉛膜 まで堆積した後、加熱乾燥することなく、取り出し、水 分量、電気抵抗、反射率の測定を行った。

【0063】その結果は、水分量が8、1×1.0-3mo l/cm<sup>1</sup>、電気抵抗は3.5~20.3Ωcm<sup>1</sup>と高抵 まで堆積した後、ポータブル電気炉(アサヒ理化製作所 20 抗でかつ不安定であり、太陽電池用基板としては不適当 であった。

> 【0064】(実施例5)実施例1~4、比較例1で作 製した5つの基板上に半導体層、透明導電層、集電電極 層を順に堆積し、太陽電池を作製した。

【0065】 ことでは半導体層としては酸化亜鉛膜側か ら材料ガスとしてSiH.、PH,、H.を用い、電力を 投入し厚み10nmのn型a-Si層を、さらにSiH 4、GeH.、H.を用い、厚み500nmのi型a-S iGe層を、さらにSiH、、BF」、H、を用い、厚み 製 AFM−10)にいれ、設定温度200℃で40秒 30 10nmのp型μc-Si層を順次形成したnip半導 体層からなる光起電力素子を用いた。なお、n型a-S i 層の成膜温度は200℃とした。

> 【0066】透明導電層としては、ITOを蒸着法にて 形成し、集電電極層としては、CF続いてAuの金属を 蒸着したものを用いた。との時の太陽電池特性の相対比 較を表2に示す。

[0067]

【寿2】

太陽電池用 基板	水分量 (mol/cm²)	変換効率	短路電流 (Jsc)	<b>ジーズ 抵抗</b> (Rs)	
英施例1	5. 0×10 <sup>-3</sup>	100	. 100	100	
宾施例 2	4. 2×10 <sup>-2</sup>	100	101	99	
赛施例3	5. 5 × 10 <sup>-3</sup>	98	98	110	
実施例4	1.11×10 <sup>-4</sup>	96	97	98	
比較例 1	8. 1×10 <sup>-3</sup>	88	96	200	

(実施例1の値を100として相対的な比較を示した)

【0068】表2から以下のととが分かる。

【0069】酸化亜鉛膜中の水分量に応じて太陽電池の シリーズ抵抗は変化している。実施例3で1割程シリー

ず問題はない。しかしながら、比較例1のように水が 8. 1×10<sup>-3</sup>mol/cm³と増えると、途端にシリ ーズ抵抗が2倍となり著しく変換効率を下げてしまう。 ズ抵抗が増えているが、変換効率はほとんど減っておら 50 【0070】実施例4のように酸化亜鉛膜中の水分量が 1. 11×10<sup>-1</sup>mol/cm<sup>3</sup>と少ない場合には、わずかではあるが短絡電流の減少があり、実用上問題にならない程度の変換効率の低下が起こっている。これは、水分量が少ない酸化亜鉛膜は表面の凹凸が不十分で乱反射率が、実施例1~3に比べ低いためと考えられる。

【0071】次に、実施例5同様の条件でn型a-Si層の成膜温度を250℃にして太陽電池を形成したところ、実施例3の基板を用いた太陽電池は、変換効率(実施例1の基板を用いた太陽電池(n型a-Si層の成膜温度200℃)の値を100としたときの相対的な値。以下、同様)が95に低下した。また、目視により、酸化亜鉛膜が黒っぽく着色するのが観察された。これは、酸化亜鉛膜中の結合水がn型層形成時に脱離した影響と考えられる。

【0072】同様に、n型a-Si層の成膜温度を300℃、350℃、とふったところ、実施例3の基板を用いた太陽電池の変換効率は300℃で90になり、350℃で80になった。また、実施例1の基板を用いた太陽電池の変換効率は、350℃で97になった。他の場合では変換効率に変化は見られなかった。一方、n型a20-Si層以外の半導体層の成膜温度も変化させてみたが、変換効率に差異は見られなかった。

【0073】これらの結果から、酸化亜鉛膜に接する半 導体層の成膜温度は、酸化亜鉛膜の乾燥温度+100℃ 以下とすることが好ましく、酸化亜鉛膜の乾燥温度以下 とすることがより好ましいことがわかる。

【0074】(実施例6)厚さ0.15mmのSUS4 30(2D表面)板を5cm角に切り出した。この板上 にスパッタ装置(ULVAC製 SBH-2208D orr)、250℃、0.25Aの定電流を印加し、ア ルミニウムを200nm、続けてアルゴン雰囲気中0. 399Pa (3. OmTorr), 250°C, 0. 5A の定電流を印加し、酸化亜鉛膜を100nm成膜した。 【0075】次に、硝酸亜鉛0、2モルとデキストリン 0. 1gを純水1リットルに溶解した水溶液をビーカー にとり、82°Cに加熱した。この水溶液中で前記スパッ タにて作製したSUS/アルミニウム/酸化亜鉛からな る基板をカソードとし、純度4Nの5cm角の亜鉛板を 可し、厚さ2.0μmの酸化亜鉛膜をSUS/アルミニ ウム/酸化亜鉛からなる基板上に成膜した。との時のア ノードと基板の間の距離は2cmとした。また、成膜中 は、磁気撹拌子で水溶液を撹拌した。

【0076】とうして得られたサンブルをボータブル電気炉(アサヒ理化製作所製 AFM-10)にいれ、設定温度350℃で10秒間加熱し、取り出し、実施例1同様に、水分量、電気抵抗、反射率の測定を行った。 【0077】その結果は、水分量が3.2×10<sup>-1</sup>mo 4%、乱反射率は50%であり、太陽電池用基板としては十分な値を示した。

12

【0078】(実施例7)実施例6と同様に酸化亜鉛膜まで堆積した後、ボータブル電気炉(アサヒ理化製作所製 AFM-10)にいれ、設定温度300℃で20秒間加熱し、取り出し、水分量、電気抵抗、反射率の測定を行った。

【0079】その結果は、水分量が2.7×10-1mo 1/cm1、電気抵抗は0.44Ωcm1、全反射率は6 10.4%、乱反射率は49%であり、太陽電池用基板としては十分な値を示した。

【0080】(実施例8)実施例6と同様に酸化亜鉛膜まで堆積した後、ボータブル電気炉(アサヒ理化製作所製 AFM-10)にいれ、設定温度250℃で30秒間加熱し、取り出し、水分量、電気抵抗、反射率の測定を行った。

【0081】その結果は、水分量が5.5×10-3mo 1/cm3、電気抵抗は3.4Ωcm3、全反射率は65%、乱反射率は50%であった。電気抵抗の値は、実施例1、実施例2に比べて少し高く、太陽電池用基板としては上限であるが、実用上は問題のない値を示した。

【0082】(実施例9)実施例6と同様に酸化亜鉛膜まで堆積した後、ボータブル電気炉(アサヒ理化製作所製 AFM-10)にいれ、設定温度500℃で20秒間加熱し、取り出し、水分量、電気抵抗、反射率の測定を行った。

【0074】(実施例6) 厚さ0.15mmのSUS4 【0083】その結果は、水分量が1.02×10<sup>-1</sup>m 30(2D表面) 板を5cm角に切り出した。この板上 にスパッタ装置(ULVAC製 SBH-2208D たが、目視上では、酸化亜鉛膜表面がわずかに黄ばんで E) で、アルゴン雰囲気中0.399Pa(3.0mT 30 いた。反射率を測ってみると波長400nm~700n mの比較的短波長の領域で全反射率、乱反射率とも数% とわずかながらの低下が見られたが、太陽電池用基板と してはぎりぎり使えるものであった。

【0084】これは、500℃の高温で20秒という比較的長い時間基板を加熱したために、一部酸素が抜けて黄ばんだと推定している。その他の実施例の結果も考慮すると、乾燥温度は200℃以上400℃以下が好ましい。

る基板をカソードとし、純度  $4 \, \text{No} \, 5 \, \text{cm} \, \text{角の亜鉛板を}$  【 $0 \, 0 \, 8 \, 5$ 】(比較例 2)実施例  $6 \, \text{と同様に酸化亜鉛膜}$  アノードとして直流電流を定電流モードで  $1 \, 8 \, 0 \, \text{mA}$  印  $0 \, \text{cm} \, \text{cm} \, \text{cm}$  まで堆積した後、全く乾燥せず、水分量、電気抵抗、反可し、厚さ  $2 \, 0 \, \mu \, \text{m}$  の酸化亜鉛膜を  $3 \, \text{CM} \, \text{CM} \, \text{CM} \, \text{CM}$  射率の測定を  $3 \, \text{CM} \, \text{CM} \, \text{CM}$  お本の測定を  $3 \, \text{CM} \, \text{CM} \, \text{CM}$  と同様に酸化亜鉛膜  $3 \, \text{CM} \, \text{CM} \, \text{CM} \, \text{CM}$  に対し、反

【0086】その結果は、水分量が9. 9×10<sup>-3</sup>mo 】/cm³、電気抵抗は5. 3~102Ωcm³と高抵抗 でかつ不安定であり、太陽電池用基板としては不適当で あった。

【0087】(実施例10)実施例6~9、比較例2で作製した5つの基板上に半導体層、透明導電層、集電電極層を順に堆積し、太陽電池を作製した。

【0077】その結果は、水分量が3.2×10<sup>-1</sup>mo 【0088】とこでは半導体層としては酸化亜鉛膜側か 1/cm<sup>1</sup>、電気抵抗は0.50Ωcm<sup>2</sup>、全反射率は6 50 ら材料ガスとしてSiH、PH,、H<sub>2</sub>を用い、電力を 投入し厚み10nmのn型a-Si層を、さらにSiH .、GeH.、H.を用い、厚み500nmのi型a-S i G e層を、さらにSiH。、BF。、Hュを用い、厚み 10nmのp型µc-Si層を順次形成し、更に同様に

a-SiGe層を有するnip半導体層を形成し、更に a-Si層を有するnip半導体層を形成してなるトリ

ブルセル型の光起電力素子を用いた。なお、最初に形成\*

14 \*したn型a-Si層の形成温度は250℃とした。

【0089】透明導電層としては、ITOを蒸着法にて 形成し、集電電極層としては、CF続いてAuの金属を 蒸着したものを用いた。この時の太陽電池特性の相対比 較を表3に示す。

[0090]

【表3】

太陽電池用蓋板	· 水分量 (mol/cm²)	変換効率	短路電流 (Jsc)	//-ズ抵抗 (Rs)	
実施例 6	3. Z×10 <sup>-3</sup>	100	100	100	
实施例 7	2. 7×10 <sup>-3</sup>	101	101	99	
奥施例8	5. 5×10 <sup>-3</sup>	99	<b>S</b> 8	112	
英旅例 9	1.02×10 <sup>-4</sup>	97	96	102	
比較何2	9. 9×10 <sup>-3</sup>	87	93	250	

(実施例6の値を100として相対的な比較を示した)

【0091】表3から以下のことが分かる。

【0092】実施例9を除いて、水分量に応じて太陽電 池のシリーズ抵抗は変化している。とれは、乾燥温度が 500℃と髙かったために、アルミニウム表面が多少酸 化され、抵抗がわずかに上がったためと思われる。

【0093】実施例8で1割強程シリーズ抵抗が増えて いるが、変換効率はほとんど減っておらず問題はない。 しかしながら、比較例2のように水が9.9×10<sup>-1</sup>m o l/c m'と増えると、途端にシリーズ抵抗が2.5 倍となり著しく変換効率を下げてしまう。

【0094】実施例9では、短絡電流の減少による変換 効率の低下がわずかに起こっている。このサンブルと実 施例5のサンプルのQ値(量子効率)を比較すると、波 長600~700nmの範囲で、トリプルセル内のミド ルセル (2番目のnip半導体層)のQ値がわずかに下 30 がっている。これは、波長400~700ヵmの範囲で の基板の反射率の低下がもたらしたものと考えられる。 【0095】次に、実施例10同様の条件で最初のn型 層形成温度を350℃にして太陽電池を形成したとと ろ、実施例7、8の基板を用いた太陽電池の変換効率 (実施例6の基板を用いた太陽電池 (n型a-Si層の 成膜温度250℃) の値を100としたときの相対的な 値。以下、同様)はそれぞれ、98、95になった。ま※

※ た、これらのサンプルでは、酸化亜鉛膜が黒っぽく着色 するのが観察された。これは、酸化亜鉛膜中の結合水が n型層形成時に脱離した影響と考えられる。

【0096】同様に、n型層形成温度を400℃とした 20 ところ、変換効率は、実施例6の基板で99、実施例7 の基板で97、実施例8の基板で89となった。

【0097】n型層形成温度が350℃の場合と400 Cの場合とで、実施例7の基板を用いた太陽電池の変換 効率にあまり変化が見られないのは、もともと酸化亜鉛 膜中に含まれる水の絶対量が少ないことも一因であると 考えられる。

【0098】以上の結果からも、酸化亜鉛膜中に含まれ る水分量は5. 0×10<sup>-1</sup> mol/cm<sup>1</sup>以下がより好 ましいことがわかる。

【0099】(実施例11)実施例1~4、実施例6~ 9、比較例1、2で作製した太陽電池用基板上に実施例 5と同様の半導体層を堆積し、透明導電層を形成する 際、0.25cm゚のマスクを用いて基板上に20個の 太陽電池を作製しその生存率 (%)を比較した結果を表 4に示す。

[0100]

【表4】

	実施例	寒施例 2	英施例 3	実施例 4	比较例 1	英維例 6	実施例 7	実施例 8	実施例 8	比較例 2
生存率	100	95	100	90	100	95	<del>6</del> 5	100	95	100

【0101】いずれの場合も、太陽電池の実用上には十 分な生存率である。しかしながら、詳細を見てみると、 水の量が1. 11×10-'mo1/cm'と他と比べて 少し少ない実施例4では、わずかながら生存率が低い。 それに対して、ある程度の水を含んでいるその他の例で は、太陽電池は程よい抵抗値を持ちシャントを引き起と しにくくなっていると考えられる。この原因は、粒界に 沿って何らかの物質が動くために電気的な導通が起とる 50 少シャントしにくくなったものと思われる。

と考えているが、水が粒界にあることで物質が動き難く なり、結果、耐環境性が向上すると考えている。

【0102】ただし、水の量が更に1.02×10~m o 1/c m³と少ない実施例9の生存率が実施例4に比 べて高いのは、前述したように、基板作製時の乾燥温度 が500℃と高かったために、アルミニウム表面が多少 酸化され、抵抗がわずかに上がったため、この影響で多

【0103】比較例1、2で生存率が高いのは、水の含 まれ過ぎによる高抵抗化が原因であると思われる。

【0104】(実施例12)厚さ0. 15mmのSUS 430 (2D表面) 板を5cm角に切り出した。この板 上にスパッタ装置(ULVAC製 SBH-2206D E) で、アルゴン雰囲気中O、399Pa (3.0mT orr)、350℃、0.3Aの定電流を印加し、銀を 200nm、続けてアルゴン雰囲気中0.399Pa (3.0mTorr)、350℃、0.5Aの定電流を 印加し、酸化亜鉛膜を100ヵm成膜した。

【0105】次に、硝酸亜鉛0.2モルとデキストリン 0. 1gを純水1リットルに溶解した水溶液をビーカー にとり、82℃に加熱した。この水溶液中で前記スパッ タにて作製したSUS/銀/酸化亜鉛からなる基板をカ ソードとし、純度4Nの5cm角の亜鉛板をアノードと ·して直流電流を定電流モードで180mA印可し、厚さ 2. 0μmの酸化亜鉛膜をSUS/銀/酸化亜鉛からな る基板上に成膜した。との時のアノードと基板の間の距 離は2cmとした。また、成膜中は、磁気撹拌子で水溶 液を撹拌した。

【0106】こうして得られたサンプルをポータブル電 気炉(アサヒ理化製作所製 AFM-10)にいれ、設 定温度300℃で10秒間加熱し、水分量を測定したと  $C54.9 \times 10^{-3} mol/cm^3 Kook, CO + 27$ ルと実施例1のサンブルを用いてJIS規格のクロスハ ッチ試験(碁盤目テープ法)と表面SEM観察を行っ

【0107】クロスハッチ試験の結果は実施例1では8 点、実施例12では10点であった。どちらも太陽電池 膜をスパッタで堆積してあった実施例12の方がより密 着性が強かった。

【0108】次に、SEM観察の結果では、銀表面に直 接成膜した実施例1では、結晶粒の成長方向が部分的に 偏っているところが見られたが、あらかじめ100nm の酸化亜鉛膜をスパッタで堆積してあった実施例12で は、結晶粒の成長方向がアトランダムであった。この結 果は、どちらの場合にも太陽電池用基板としては問題な く使用できるが、特に、工業的生産を考え大面積化をし の方が有利である可能性を示唆している。

【0109】上記の実施例同様、水を含有する雰囲気下\*

\*で雰囲気中の水の量を種々変えてスパッタリング法によ り酸化亜鉛膜を形成し、太陽電池を作製したところ、膜 中水分量が4. 0×10-mol/cm<sup>3</sup>以上7. 5× 10-3mol/cm3以下の範囲の酸化亜鉛膜を有する

[0110]

【発明の効果】以上示したように、酸化亜鉛膜中に7. 5×10<sup>-1</sup>mol/cm<sup>3</sup>以下、好ましくは4.0×1 0-1mol/cm³以上のある程度の水を含んだ太陽電 10 他用基板は、総合的に見て最適であると言える。

太陽電池では良好な特性が得られた。

【0111】本発明の太陽電池用基板は、ある程度の水 を含んでいるために太陽電池には程よい抵抗値を持ちシ ャントを引き起としにくくすることができる。この原因 は、粒界に沿って何らかの物質が動くために電気的な導 通が起こると考えているが、水が粒界にあることで物質 が動き難くなり、結果、耐環境性が向上する。

【0112】また、ある程度水を含んでいるため、水が 存在するための粒界のようなものが通常のスパッタ等の プロセスで作った酸化亜鉛膜より多いため、どつどつと 20 岩がころがっているような形状を形成すると思われる。 そのため、高い乱反射率が得られ、結果として高いJs cが得られる。

【0113】また、特に、水溶液からの電気化学的反応 による電析法により形成された酸化亜鉛膜では、水分中 に含まれる酸素のおかげで、スパッタ等のプロセスで作 った酸化亜鉛膜に比べて、わずかながら亜鉛に対して酸 素リッチな酸化亜鉛膜となり、全反射率がわずかに上が り、効率が上がる。

【0114】また、上記わずかながら亜鉛に対して酸素 として問題はないが、あらかじめ100nmの酸化亜鉛 30 リッチな酸化亜鉛膜であるがために、この基板上に太陽 電池(半導体膜)を形成する際の還元雰囲気中でも化学 的に安定で、電気的特性、光学的特性を損なわれない。

【0115】また、特に、予め下引きに酸化亜鉛膜を1 層設けてやることにより、密着力のある均一な酸化亜鉛 膜が得られ、工業的にも優れた太陽電池用基板が得られ

【0116】また、水溶液を用いて酸化亜鉛膜を形成し た後に乾燥する温度を、直後に形成される半導体層の形 成温度−100℃以上、より好ましくは形成温度以上と た場合、特性の均一性という観点からは多少実施例12 40 することで、酸化亜鉛膜中の結合水が半導体層形成工程 に悪影響を与えることを防ぐことができる。

フロントページの続き

(72)発明者 宮本 祐介

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内

Fターム(参考) 5F051 AA04 AA05 CB11 CB15 CB24 DA04 FA04 FA14 GA02 GA06

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.